

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成17年9月22日(2005.9.22)

【公開番号】特開2004-269898(P2004-269898A)

【公開日】平成16年9月30日(2004.9.30)

【年通号数】公開・登録公報2004-038

【出願番号】特願2004-130037(P2004-130037)

【国際特許分類第7版】

C 0 9 D 7/12

B 0 1 J 21/08

B 0 1 J 35/02

B 0 1 J 37/02

C 0 9 D 5/02

C 0 9 D 5/16

C 0 9 D 127/12

C 0 9 D 183/04

C 0 9 D 201/00

C 0 9 K 3/00

【F I】

C 0 9 D 7/12

B 0 1 J 21/08 M

B 0 1 J 35/02 J

B 0 1 J 37/02 3 0 1 R

C 0 9 D 5/02

C 0 9 D 5/16

C 0 9 D 127/12

C 0 9 D 183/04

C 0 9 D 201/00

C 0 9 K 3/00 R

【手続補正書】

【提出日】平成17年5月9日(2005.5.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a) 光触媒性酸化物粒子と、(b) 疎水性樹脂エマルジョンと、(c) 水と、(d) シリカ粒子と、を少なくとも含んだ光触媒性コーティング剤であって、前記(a)成分および(d)成分の平均粒径は、前記(b)成分中に分散した粒子の平均粒径よりも小さく、基材に塗布することにより、膜厚1 μm～1 mmの塗膜が形成され、前記(b)成分中に分散した粒子が下方に移動することを特徴とする光触媒性コーティング剤。